# イメージングプレートの 線及び 線に対する特性

## 高田 茂\* 小山元子\* 谷崎良之\*

Response of Imaging Plate to alpha-rays and gamma-rays

Shigeru TAKATA, Motoko KOYAMA and Yoshiyuki TANIZAKI

Abstract Characteristics of Imaging Plate to alpha-rays and gamma-rays were studied. Gamma-ray energy dependence of the response of the Imaging Plate was measured by irradiation of gamma-rays with different energy which was emitted from Am-241,Cs-137 and Co-60. As a result, the PSL value to one gamma-ray from these nuclides was 3.1x10 -3,3.1x10-4 and 3.6x10-4 respectively. Also, the PSL value per 1 keV absorbed energy in Imaging Plate was 1.4x10-4,2.3x10-4 and 3.4x10-4 respectively. Possibility of alpha-ray counting by Imaging Plate was examined using alpha-ray emitted from Np-237. As a result, when the incident alpha-ray was perpendicular to Imaging Plate, the number of incident alpha particles could be measured by counting spot images in the picture taken by the Imaging Plate. When the incident alpha-ray was diagonal, the number of incident alpha particles could be estimated by comparing the picture of the sample with the picture of standard alpha-ray source.

Keywords Imaging plate, gamma-ray sensitivity, alpha-ray counting, Am-241, Cs-137, Co-60, Np-237

### 1.はじめに

放射線の2次元分布を測定することは,放射線透過試 験やオートラジオグラフィなどの分野で,基本となって いる技術である。現在,放射線2次元分布測定器にはX 線用フィルムをはじめ,イメージングプレート<sup>11</sup>,X線C CDカメラ<sup>21</sup>,フラットパネルディテクタ<sup>31</sup>などが実用化 されている。特に輝尽発光体を利用したイメージングプ レート(IP)は,開発当初から放射線検出器としての 性能の良さ<sup>11</sup>が注目され,放射線診断や非破壊検査など様 々な分野に普及している。

IPは広く使われているにもかかわらずその放射線測定 器としての特性が十分に明らかにされていない。これは IPが放射線測定器としてではなく「従来の病院におけ るレントゲン写真撮影から画像診断までの流れを変えな いデジタルX線イメージングシステム」<sup>4</sup>の一部として開



図1 IPの 線エネルギー特性測定のための照射方法

\*精密分析技術グループ

核種	壊変率	線	放出率	吸収エネルギー*
	MBq	keV		keV
<sup>1 3 7</sup> Cs	2.76	661.7	0.851	1.27
		37.5	0.0026	
		36.4	0.0104	
		32.2	0.0377	
		31.8	0.0205	
<sup>60</sup> Co	2.26	1173.2	0.9992	1.05
		1332.5	1.000	
<sup>2 4 1</sup> Am	2.70	59.5	0.359	9.95
		33.2	0.0012	
		26.3	0.0241	
		21.0	0.052	
		17.6	0.202	
		15.9	0.0033	
		14.0	0.13	

表1 線応答特性の測定に用いた線源とその特性<sup>5)</sup>

\* 1 壊変で放出される 線がすべて I P に垂直に入射した場合, I P の蛍光層で吸収されるエネルギー

発されたためと思われる。IPの応用範囲が大きく広が った現在,IPの放射線測定器としての基本性能は不可 欠な情報である。本研究では,線透過試験で重要な要 素である線エネルギー応答特性と半導体製造分野で注 目されている微量線計測への応用の可能性について調 べたので報告する。

2.方 法

2.1 IPの 線エネルギー応答特性

IPは 線が入射するとそのエネルギーの一部を吸収

東京都立産業技術研究所研究報告 第2号(1999)

・蓄積し,刺激光を受けるとその蓄積エネルギーを輝尽 光として放出する性質を持っている。これまでに、輝尽 光の量が入射 線のエネルギーに依存することは知られ ているが,そのエネルギー依存性を定量的に扱った報告 はない。そこで,エネルギーの異なる 線を放出する三 種類の線源を用いて,それぞれの 線に対する IPの輝 尽光量を測定した。実験に用いた線源はプラスチック円 盤に封入された直径1mm 以内の点状線源である。それ ぞれの核種,壊変率及び放出 線は表1に示した。IP は富士写真フィルム製 SR2025を使用した。 線の照射は IPを遮光性の薄いプラスチック袋に入れ,図1に示す ようにIP表面から3cm離した位置に線源を置いて行っ た。照射時間は2時間とし,照射後5分以内に読み取りを 行った。照射から読み取りまでのフェーディング効果に ついては考慮しなかった。IPの応答はIP専用読み取 り器である BAS-5000MAC で測定した。BAS-5000MAC は<br />
I<br />
P<br />
の<br />
応答を<br />
I<br />
P<br />
面<br />
上の<br />
微<br />
小<br />
面積<br />
(<br />
ピ<br />
ク<br />
セル<br />
)<br />
当たり<br /> の発光量で表示するようになっている。ここでは、微小 面積を25µm 平方に設定した。輝尽光の量は物理量で測 定することが望ましいが,BAS-5000MAC では「IPに WターゲットでX線(80kV,照射線量:0.15mR)を照 射した後の輝尽性蛍光の発光により得られるシステムの 検出量の値を100PSL/mm<sup>2</sup>と定義する」<sup>6)</sup>と規定された PSL あるいはその対数圧縮量である QL という独自の単 位で出力されるので、これらの単位で測定した。応答特 性は各ピクセルに入射した 線の個数とそのピクセルか らの PSL 値を比較することで測定した。各ピクセルへの

線の入射個数 は,次式により計算した。

ここで,A は線源の壊変率(Bq),f は 線の放出率,S はピクセルの面積(mm<sup>2</sup>),r は線源とピクセル中心の距 離(mm)である。

線源とピクセルの距離が大きくなると、入射 線はI P面に斜めに入射するようになる。しかし、IPの蛍光 層の厚さ120µmと線の透過力を考慮すると、線の 検出は1ピクセルを底面とし高さ120µmの立体全体で ほぼ均等に行われることが分かる。従って、上式では入 射線に対するIP面の傾きは考慮していない。

2.2 微量 線計測への応用

IPによる 線の計数測定は, 線放出率が値付けら れている標準線源ネプツニウム-237(<sup>237</sup>Np):26.4 /s/2 を用いて行った。IP面に 線が通過する厚さ 6µm の汚染防止用マイラーフィルムを被せ,その上に 線源を密着させ39秒及び67秒間放置してから輝尽光画像 を読み出し,その画像から 線による像を検出すること を試みた。この方法は実際の試料測定に近い形態である が、IP面に斜めに入射する 線が多くなるため、明瞭 な 線の像が得られない可能性がある。そこで、IP面 に 線が通過しない厚さ60µmのフィルムを置き、その フィルムに直径約10mmの穴をあけた。線源を穴の真上 にIP面から10mm離して28分間放置した後、密着と同 様の測定を行った。この形態では 線はほとんどIP面 に90度から60度までの角度で入射する。実験に用いた装 置は 線測定の場合と同じであるが、IPは表面の保護 膜がないTR2025を使用した。

## 3.結果及び考察

3.1 IPの 線エネルギー応答特性

図1のような照射条件では,線源の真下の PSL 値が最 も多い,同心円状の画像が得られる。図2にセシウム-13 7(<sup>137</sup>Cs)線源の真下を通る直線上のピクセルにおける PSL 値を示した。図中に表示した実線は式(1)から



図 2 <sup>137</sup>Cs 線源からの距離が異なるピクセルにおける PSL 値。

横軸中央が線源の真下約3cm にあたる。実線は式(1)による計算値。



図 3 IP(SR2520)の 線のエネルギーに対する感度特性。 は主要 線の入射個数に対する感度。 は IP 蛍光層で の吸収エネルギーに対する感度。

東京都立産業技術研究所研究報告 第2号(1999)

計算した各ピクセルごとの入射 線個数に定数を乗じた ものである。図から明らかなように、この定数を最小二 乗法で決めることにより,実測 PSL 値と計算値を良く-致させることができた。この定数3.1×10<sup>-4</sup>は<sup>137</sup>Csの 線(662keV)1個当たりのIPの PSL 値, すなわち662 keV 線に対する感度 (PSL/photon) と考えることがで きる。コバルト-60 ( °°Co) 及びアメリシウム-241 (<sup>241</sup>Am)の 線についても同様のことを行ない,それ ぞれの 線に対する感度を求めた。その結果を,図3に 菱形印で示した。<sup>6°</sup>Co及び<sup>241</sup>Amからの 線に対する 感度はそれぞれ3.6×10<sup>-4</sup>, 3.1×10<sup>-3</sup>であった。なお, 図3では,各線源から放出される主要 線に対するエネ ルギー応答特性として示した。すなわち,<sup>241</sup>Am からは 60keV, <sup>137</sup>Cs からは662keV, <sup>60</sup>Co からは1173keV 及び 1333keV の 線だけが出ているとして感度を計算した。 図3から,使用したIPは60keVの 線に対する感度が6 62keV や1173keV 及び1333keV の 線に対する感度より 約10倍高いことが分かる。この違いは, IP蛍光層で吸 収される 線のエネルギーの差によるものと考えられる。 そこで,実際にIPの蛍光層で吸収されるエネルギーに 対する PSL 出力を比較した。 I P の 蛍光層は バリウム (Ba)や臭素(Br)という比較的原子番号が大きい元素 を含むため,低エネルギー 線に対するエネルギー吸収 係数は急速に増加する。従って,考慮する 線は前述の 主要 線だけでなく,副次的な 線や特性X線も含めた。 表1に,各線源からの 線とX線及び計算された吸収工 ネルギーを示した。このようにして得た吸収エネルギー に対する感度は1.4×10<sup>-4</sup> PSL/keV, 2.3×10<sup>-4</sup> PSL/keV, 3.4×10<sup>-4</sup> PSL/keV となった。その値を図3に丸印で表 示した。 I P の発光原理から考えると, ピクセル当たり の PSL 値はピクセル当たりの吸収エネルギーだけに依存 し,従って,吸収エネルギー当たりの PSL 値は入射 線 のエネルギーには無関係,つまり核種に依存しないはず である。しかし,図3の丸印は<sup>241</sup>Am,<sup>137</sup>Cs,<sup>60</sup>Coの 順に吸収エネルギーに対する感度が高くなっており、 <sup>60</sup>Co は<sup>241</sup>Am より約2.4倍高いことを示している。この 理由は,線源容器による低エネルギー 線の吸収,蛍光 層による 線減弱のエネルギーによる違い,読み出し刺 激光の蛍光層による減衰及び放出輝尽光の蛍光層による 自己吸収などが相互に関係しているのではないかと考え られるが,現在のところ明らかでない。以上から,応答 特性が未知の核種に対して,その核種が放出する 線の エネルギーと放出割合やIPの蛍光層による 線の吸収 エネルギーを計算することにより,前もって IPの出力 を予想することができるようになった。

3.2 微量 線計測への応用

標準 線源を用いて 線を照射したときに得られた画



図5 1 cm 離して照射した場合の 線画像

像を図4と5に示した。図4は線源をIP面に密着した 場合,図5は線源をIP面から1cm離して,直径1cm の穴を通した場合の画像の例である。なお,画像は一定 PSL値を境に二値化して表示してある。これらの画像か らは線によると考えられる点状の画像が観察され,こ の点状像の個数を数えることで線の計数が可能なよう に思われる。実際に二値化するPSL値を変化させて,計 数される点状像の個数を調べると図6のようになった。 図6はPSL値を対数圧縮したQL値に変換して示してあ る。図から明らかなように,線源を離した場合は二値 化レベルを変化させても点状像の個数が変わらない部分 があり,その値を線の個数と見なすことができる。こ れは<sup>237</sup>Npからの線が4.8MeVという高いエネルギー を持ち,IPの蛍光層内での飛程が15µmと短く,しか もIP面に垂直に近い角度で入射するため,1個の線 は1個か2個のピクセルにだけ入射し, 線が入射しな かったピクセルとは輝尽光の強さが大きく異なるためと 考えられる。しかし,線源を密着した場合は,二値化レ ベルを下げるに従って,点状像の個数が増加し,画像だ けから 線の個数を特定することはできないことが分か った。これは密着の場合,IP面に浅い角度で入射する

線が汚染防止のフィルムを斜めに通過することにより 多くのエネルギーを失い, PSL 値の少ないピクセルが増 加するためと思われる。

さらに, 線源から放出される 線の個数と点状像の 数を比較した。線源を離した場合,線源を点線源と見な して 線放出率から穴を通過した 線の個数を計算する と,線源を1cm離した場合の点状像の個数は,入射 線 の87%となった。このことは, 線がIPに垂直に近い



図 6 線照射画像の LOW QL 以上の点状像の個数。 は1cm 離して照射した場合。 は密着して67秒間照射 した場合。 は密着して39秒間照射した場合。



図7 線スペクトロメータとイメージングプレートに よるセミック板表面からの 線個数測定値

角度で入射する場合は,点状像の個数を 線の個数と考 えても大きな違いがないことを示している。一方,密着 画像における点状像の個数と計算された入射 線の個数 を比較すると,およそ QL 値で35000あたりの個数が入射

線の個数に対応していることが分かった。この結果を 用いて,3種類のセラミック板を3日間IPに密着させ て得た画像から, 線の放出率を求め,表面障壁型 Si 半 導体 線スペクトロメータによる測定結果と比較したの が図7である。両方の測定結果は傾向としてよく一致し ているが、IPの測定値の方がバックグラウンド値が高 く,バックグラウンドを引いた値は 線スペクトロメー タの測定値の約2倍になっている。これは 線スペクトロ メータが 線以外にはほとんど感度がなく,バックグラ ウンド計数率も非常に低いのに対して, IPは 線や 線にも感じるためと思われる。以上から, セラミック板 の表面から放出される 線の計数は, 線がIP面に垂 直に近い角度で入射する場合は画像を解析するだけで可 能であることが分った。また,密着して測定する場合は 標準線源などで,あらかじめ 線を分離する二値化レベ ルを決めておくことが必要である。

## 4.まとめ

IP(SR2520)の 線に対する応答特性は<sup>241</sup>Amの 線に対して 3.1×10<sup>-3</sup> PSL/photon,<sup>137</sup>Csの 線に対し て 3.1×10<sup>-4</sup> PSL/photon, <sup>60</sup>Co の 線に対して 3.6 ×10<sup>-4</sup> PSL/photon であった。また, IPの蛍光層での吸 収エネルギーで比較すると,それぞれ1.4×10<sup>-4</sup> PSL/keV, 2.3×10<sup>-4</sup> PSL/keV, 3.4×10<sup>-4</sup> PSL/keV となった。吸収 エネルギーでの応答特性は核種による違いが少ないので, 応答特性が分かっていない核種についてもある程度の応 答特性を予想できるようになった。 線については, 線がIPへ垂直に近い角度で入射する場合は,入射した 個々の 線に対応した点状の像が得られ,その像の数を 数えることで微量 線を計数できた。しかし,試料をI Pに密着させた場合は 線による像と他の原因による像 を明確に区別することが困難であった。この場合,標準 試料による像との比較により, 線を計数することが可 能であった。

#### 参考文献

- 高田茂,小山元子,櫻井昇,渡辺是彦,谷崎良之: 東京都立産業技術研究所研究報告第1号,52-55, (1998).
- 2)伊藤和輝,雨宮慶幸:放射線,25,39-52(1999).
- 3) 稲邑清也:新医療,292,4月号,72-77(1999).
- 4) 宮原諄二:保健物理,34,24-28(1999).
- 5 ) E. Browne, R. B. Firestone: Table of Radioactive Isotopes, John Wiley & Sons(1986).
- 6) BAS Technical Information No.1.,富士写真フィルム (1993).

(原稿受付 平成11年8月9日)